

京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点利用内規

(平成23年3月23日拠点マネージャー裁定)

(趣旨)

第1条 この内規は、京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点(以下「ハブ拠点」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 ハブ拠点が設置供用する装置及び実験室等のうち、別表第1に定める装置群(以下「装置群」という。)及び別表第2に定める実験室等(以下「実験室等」という。)について、科学技術の発展に資する研究開発に係る実験研究の利用に供するものとする。

(利用日)

第3条 ハブ拠点の装置群及び実験室等の利用日は、次の各号に掲げる以外の日とする。

- (1) 日曜日及び土曜日
- (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- (3) 12月29日から翌年1月3日まで(祝日法による祝日を除く。)
- (4) 6月18日(創立記念日)

2. 前項の規定にかかわらず、運営責任者(京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点要項第3第1項の規定によるものをいう。以下同じ。)が特に必要と認めるときは、臨時に利用させ、又は利用を中止させることがある。

(利用時間)

第4条 ハブ拠点の装置群及び実験室等の利用時間は、午前9時から午後5時15分とする。

2 前項の規定にかかわらず、運営責任者が特に必要と認めるときは、その時間を延長し、又は短縮することがある。

(利用者の資格)

第5条 装置群又は実験室等(以下「装置群等」という。)を利用することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

- (1) 本学の教職員及び学生
- (2) 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
- (3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者
- (4) その他、運営責任者が特に必要と認めたる者

(利用形態)

第6条 利用者の利用形態は以下のとおりとする。

- (1) 技術相談

(2) 装置群等の利用

(3) 技術代行及び技術補助（以下「技術代行等」という。）

（利用の申請）

第7条 装置群等を利用しようとする者は、所定の申請書を運営責任者に提出し、その許可を受けなければならない。なお、利用期間は許可を受けた日から最長で1年とする。また、利用期間終了後も継続して利用したい場合には、再度申請を行うものとする。

2. 技術相談を利用しようとする者は、ハブ拠点と打合せを行い、相談の回答にハブ職員が装置群等を使用する必要がある場合は所定の申請書を運営責任者に提出し、その許可を受けなければならない。

3. 技術代行等を利用しようとする者は、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業に則って研究成果の公開についてあらかじめハブ拠点と合意し、所定の申請書を運営責任者に提出し、その許可を受けなければならない。

4. 運営責任者は、第1項、第2項及び第3項により利用を許可した者に対して、その旨を通知するものとする。

5. 運営責任者は、第1項、第2項または第3項の許可に際し必要と認めるときは、当該利用について必要な条件を付すものとする。

6. 第1項、第2項または第3項の許可を受けた者は、当該装置群等の利用に関し責任者（以下「利用責任者」という。）となる。

7. 利用責任者は、利用の許可を受けた後において、利用日時を変更する場合は、速やかに運営責任者に申し出て、その許可を受けなければならない。

8. 利用責任者は、利用の許可を受けた後において、自己の都合により利用を中止する場合、速やかに運営責任者に届け出なければならない。

（利用責任者の責務）

第8条 利用責任者は、装置群等の利用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守し、適正に利用しなければならない。

(1) 利用を許可された装置群について、高度専門技術職員等による十分な教育を受けること。

(2) 利用を許可された装置群等及びその設備、備品等の保全に努めること。

(3) 利用を許可された目的以外に使用しないこと。

(4) 利用を許可された装置群等及びその設備、備品等を他の者に一部又は全部を転貸しないこと。

(5) 利用を許可された装置群等及びその設備、備品等に対し、運営責任者の許可なく改造・変更などを行わないこと。

(6) その他運営責任者が定め、又は指示する事項に従うこと。

（利用の許可の取消等）

第9条 運営責任者は、次の各号の一に該当する場合、装置群等の利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 利用責任者が、この内規に違反し、又は違反するおそれがあると運営責任者が認めるとき

(2) 利用責任者が、所定の申請書に虚偽の記載をしたとき

(3) 本学において、管理上の事由が生じたとき

(報告義務)

第10条 利用責任者は、運営責任者からその利用にかかる事項について報告を求められた場合は、それに応じなければならない。

(利用負担金等)

第11条 利用責任者は、本学の指定する方法により、利用負担金等を納付しなければならない。

2. 利用負担金等の額は別途定めるところによる。

3. 一旦納付された利用負担金等は、返還しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、利用負担金等の全部又は一部を返還する。

(1) 本学の都合により利用の許可を取り消し又は利用を中止した場合

(2) 利用責任者の都合により、装置群の利用を中止したときに、納付された利用負担金等を第5項に規定するキャンセル料に充当したうえで、残額がある場合

4. 利用負担金等は、本学の発行する請求書により、請求書発行日の翌月末までに納付しなければならない。

5. 装置群の利用について、第7条の届出を本学において受理した日が、利用日の30日前以後の場合、別に定めるキャンセル料を納付しなければならない。ただし、当該利用に係る利用負担金等が、すでに納付されている場合は、その利用負担金等をキャンセル料に充当する。

(消耗品等)

第12条 装置群等で使用する消耗品及び材料等は原則利用責任者が準備し、負担するものとする。

2. ハブ拠点にある消耗品及び材料等を使用した場合は、その実費を負担するものとする。

3. 利用責任者が準備し、負担する材料については、本学の諸規程に従い運営責任者が使用を認めたもののみとする。

(損害賠償)

第13条 利用責任者は、本人又は当該利用にかかる関係者がその責に帰すべき事由により装置群等及びその設備又は物品を滅失、破損または汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(原状回復)

第14条 利用責任者は、当該装置群等の利用を終えたとき（第8条の規定により利用の取り消し、又は利用を中止した場合を含む。）は、直ちに原状に回復して返還しなければならない。ただし、運営責任者が特に認めたときは、この限りではない。

2. 利用責任者が原状回復の義務を履行しないときは、運営責任者は利用責任者の負担においてこれを行うことができる。この場合利用責任者は、運営責任者に異議を申し立てることができない。

(装置等利用の明記)

第15条 利用責任者は、装置群を利用して行った研究の成果を論文等により公表するときは、当該論文等に、ハブ拠点及び当該装置を利用した旨を明記するものとする。

(免責)

第16条 ハブ拠点は、利用者がその目的を達成するように協力、支援するが、その結果を保証するものではない。

2. ハブ拠点は、利用者がハブ拠点の設備群等の利用によって利用者に生じた損害について、利用者に責任を負わないものとする。

3. ハブ拠点の設備群等の利用に基づく利用者による商品の販売、役務の提供、その他の行為によって利用者に損害が発生した場合にも、ハブ拠点は利用者に対し責任を負わないものとする。

(安全衛生管理)

第17条 利用責任者及びハブ拠点の装置群等の利用にかかる関係者は、当該ハブ拠点における安全衛生管理について、関係する法令及び本学の諸規程（以下「法令等」という。）を遵守するとともに、法令等に基づき運営責任者が行う指示に従わなければならない。

2. 利用責任者は、騒音、振動、水質汚濁及び悪臭等の環境問題が発生しないよう、予防措置を講ずるものとし、問題が発生した場合は、利用責任者の責任において速やかに解決のための措置を講じなければならない。

3. 前項の問題が解決されない場合は、運営責任者は、装置群等の利用の許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。

(秘密保持)

第18条 ハブ拠点は業務上知りえた、利用者の機密である旨文書で明示された技術上の情報（開示の際に機密である旨を明示して口頭で開示された技術上の情報で、開示後速やかに書面により機密である旨明示された情報を含む。以下「秘密情報」という。）について、第三者に対し本秘密情報を開示又は漏洩してはならない。

2. ハブ拠点は、法令により開示が義務付けられているとき、又は主務官庁若しくは裁判所その他の公的機関より法令に基づき開示の請求を受けたときは、第1項の規定にかかわらず、本秘密情報の開示を必要かつ相当な範囲で行うことができる。

3. 前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとする。

- (1) 利用者から開示を受けた際、既に自らが所有していた情報。
- (2) 利用者から開示を受けた際、既に公知又は公用であった情報。
- (3) 利用者から開示を受けた後、自らの責によらずに公知又は公用となった情報。
- (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず適法に入手した情報。
- (5) 利用者が事前に文書により開示を承諾した情報。

4. 利用者相互における秘密保持に関しては、利用者自身の管理に委ねるものとし、ハブ拠点は一切の責務を負わないものとする。

5. 秘密情報の取扱いに関し、前各項に定めるもの以外に必要な事項がある場合は、別途協議して決定するものとする。

(知的財産権)

第19条 利用者のハブ拠点の装置群等の利用の結果生じた知的財産権の取扱い等については、当該発明等の発生事態を勘案して、別途協議して決定するものとする。

(法令順守)

第20条 利用者は、京都大学と締結する契約あるいは約款、及びその他京都大学の定める事項、及び自身が所属する機関の規則を遵守すること。

2. ナノハブの利用における特定不正行為（捏造、改ざん及び盗用など）及びその外不正行為を行わないこと。

(その他)

第21条 この内規に定めるもののほか、装置群等の利用に関し必要な事項は、運営責任者が定める。

附則

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この内規は、平成23年10月1日から施行する。

附則

この内規は、平成24年12月1日から施行する。

附則

この内規は、平成24年12月16日から施行する。

附則

この内規は、平成25年10月1日から施行する。

附則

この内規は、平成29年6月15日から施行する。

別表第1 装置群

装置群			
微細加工装置群	A	吉田キャンパス ／桂キャンパス	ナノリソグラフィー装置群
	B	吉田キャンパス ／桂キャンパス	ナノ材料加工・創製装置群
	C	吉田キャンパス	ナノ材料分析・評価装置群
微細構造解析装置群	D	宇治キャンパス	ナノ微細構造解析装置群

別表第2 実験室等

区分	実験室等	
a	吉田キャンパス ／桂キャンパス	クリーンルーム (イエロールーム、クリーンルーム1、クリーンルーム 2、桂クリーンルーム)
b	吉田キャンパス	加工・評価室 (加工・評価室、加工・評価室B F)
c	吉田キャンパス	サテライトラボ (専有部分)
d	吉田キャンパス	サテライトラボ (共有部分)
e	吉田キャンパス	セミナー室

京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点

利用負担金内規

(平成23年 3月 23日拠点マネージャー裁定)

(趣旨)

第1条 京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点利用内規(以下「利用内規」という。)第11条の規定に基づき負担すべき、装置等の利用負担金、基本料金及び技術料並びに実験室等の利用料金(以下「利用負担金等」という。)の額等については、この内規の定めるところによる。

(利用負担金等の額)

第2条 装置等を利用する場合の利用負担金等の額は、利用負担金及び基本料金の合計額とする。

2 ナノテクノロジーハブ拠点(以下「ハブ拠点」という。)職員による装置等の使用が必要な技術相談を利用する場合の利用負担金等の額は、利用負担金とする。

3 技術代行及び技術補助並びに事前講習(以下「技術代行等」という。)を利用する場合の利用負担金等の額は、利用負担金及び技術料の合計額とする。

(利用負担金の額)

第3条 利用負担金の額は、別表第1に定める額とする。

2 利用負担金が、別表第2の負担上限額と同一の利用許可における利用負担金の累積額との差額を超える場合には、その差額を利用負担金の額とする。

(利用負担金の割り増し)

第4条 利用内規別表第1の微細構造解析装置群(別表第1のD)の装置等を成果非公開で利用する場合は、別表第1に定める額に2割5分増額した額を利用負担金とする。

(利用負担金の上限)

第5条 利用者は希望により別表第2の負担上限額をあらかじめ納付しておくことにより、装置等の利用負担金を都度納付することなく利用ができる。この場合、使用実績に応じた利用負担金の累積額が別表第2の負担上限額を下回る場合にも、いったん納付された負担上限額との差額は返還しない。

(基本料金の額)

第6条 基本料金の額は、別表第3に定める額とする。

(技術代行等における技術料の額)

第7条 技術代行等における技術料の額は、別表第4に定める額とする。

(サテライトラボ、セミナー室の利用料金の額)

第8条 実験室等のうち、サテライトラボ(専有部分)及びセミナー室を利用する場合の利用料金の額は、別表第5のとおりとする。

(利用負担金等の割引)

第9条 利用内規第5条第1項第1号及び第2号に掲げる者(以下「1号利用者」という。)

については、別表第1、3及び4(事前講習及び微細構造解析装置群利用者の技術補助の技術料に限る。)に定める利用負担金等の半額とする。

2 利用内規別表第1の微細加工装置群(別表第1のAからC)の装置等を利用する場合においては、利用内規第5条第1項第3号に掲げる者のうち、文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業に則って研究成果を公開することについてあらかじめハブ拠点と合意した者(以下「成果公開利用者」という。)であって、その所属する機関が中小企業基本法第2条における中小企業者の範囲に含まれる者(以下「2号利用者」という。)については、別表第1、3及び4(事前講習の技術料に限る。)に定める利用負担金等の半額とする。

3 利用内規第5条第1項第3号に掲げる者のうち、成果公開利用者であって、前項に掲げる者を除く者(以下「3号利用者」という。)については、別表第1、3及び4(事前講習の技術料に限る。)に定める利用負担金等の8割に相当する額とする。

4 利用内規第5条第1項第3号に掲げる者のうち、成果公開利用者であって、学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者(以下「4号利用者」という。)については、別表第1、3及び4(事前講習の技術料に限る。)に定める利用負担金等の半額とする。

5 利用内規第5条第1項第3号に掲げる者のうち、学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者であって、前項に掲げる者を除く者(以下「5号利用者」という。)については、別表第1、3及び4(事前講習の技術料に限る。)に定める利用負担金等の8割に相当する額とする。

6 ハブ拠点で準備した標準試料を用いて、微細加工装置群を利用する事前講習を受講する者については、利用負担金等の額を別表第1に定める額の半額とする。ただし、前5項に掲げる者(1号利用者から5号利用者)については、前5項の規定による割引後の利用負担金等の半額とする。

(キャンセル料の額)

第10条 装置等の利用中止に係るキャンセル料の額は、別表第6に定める額とする。

(その他)

第11条 この内規に定めるもののほか、利用負担金等及びキャンセル料に関し必要な事項は、運営責任者が定める。

附 則

この内規は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成23年10月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成24年12月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成24年12月16日から施行する。

附 則

この内規は、平成25年10月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成26年8月1日から施行する。

附 則

この内規は、平成29年4月1日から施行する。

表 1. 装置等の利用負担金表

装置群	装置等			利用料金(一時間当り)			設置場所
	No.	機器名	メーカー名	タイプA	タイプB	タイプC	
A ナノリソグラフィ装置	A1	高速高精度電子ビーム描画装置	(株)エリオニクス	26,430円	42,290円	52,870円	イロールーム
	A2	露光装置 (ステッパー)	(株)ニコン	10,570円	16,920円	21,150円	イロールーム
	A3	レーザー直接描画装置	(株)日本レーザー(Heidelberg Instruments社)	7,170円	11,480円	14,350円	イロールーム
	A4	高速マスクレス露光装置	(株)ナリスシステムソリューションズ	4,080円	6,530円	8,160円	イロールーム
	A5	両面マスクライター	ズース・マイクロテック(株)	2,850円	4,560円	5,700円	イロールーム
	A6	紫外線露光装置	ミカサ(株)	440円	710円	880円	イロールーム
	A7	厚膜フォトレジスト用スピナー装置	ズース・マイクロテック(株)	1,560円	2,490円	3,110円	イロールーム
	A8	レジスト塗布装置	(株)カナメックス	790円	1,270円	1,590円	イロールーム
	A9	スプレーコータ	ウシオ電機(株)	1,010円	1,610円	2,010円	イロールーム
	A10	レジスト現像装置	(株)カナメックス	790円	1,270円	1,590円	イロールーム
	A11	ウエハスピン洗浄装置	(株)カナメックス	1,470円	2,360円	2,950円	イロールーム
	A12	ICP質量分析装置	アジレント・テクノロジー(株)	2,450円	3,930円	4,910円	イロールーム
	A13	超微細インクジェット描画装置	(株)SDIテクノロジー	1,080円	1,720円	2,150円	イロールーム
	A14	有機現像液型レジスト現像装置	(株)カナメックス	1,060円	1,690円	2,110円	イロールーム
	A15	大面積超高速電子線描画装置	(株)アドバンテスト	34,890円	55,830円	69,780円	加工・評価室1
B ナノ材料加工・創製装置	A51	E B 露光装置	(株)東京テクノロジー	970円	1,550円	1,930円	桂グリーンルーム
	A52	ステッパー	(株)大日本科研	9,350円	14,960円	18,700円	桂グリーンルーム
	A53	移動マスク紫外線露光装置	(株)大日本科研	4,320円	6,910円	8,630円	桂グリーンルーム
	A54	両面マスクライター露光装置	ユニオン光学(株)	680円	1,080円	1,350円	桂グリーンルーム
	B1	多元スパッタ装置 (仕様 A)	キャンアネルバ(株)	4,040円	6,470円	8,080円	加工・評価室1
	B2	多元スパッタ装置 (仕様 B)	キャンアネルバ(株)	3,850円	6,160円	7,700円	加工・評価室1
	B3	電子線蒸着装置	キャンアネルバ(株)	3,170円	5,080円	6,340円	グリーンルーム
	B4	真空蒸着装置	(株)サンバック	620円	1,000円	1,250円	加工・評価室1
	B5	プラズマCVD装置	住友精密工業(株)	6,420円	10,270円	12,840円	グリーンルーム1
	B6	集束イオンビーム走査電子顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)	12,950円	20,710円	25,890円	加工・評価室1
	B7	熱酸化炉	光洋サーモシステム(株)	940円	1,500円	1,870円	グリーンルーム2
	B8	深堀りドライエッチング装置	サムコ(株)	5,270円	8,430円	10,540円	グリーンルーム1
	B9	磁気中性線放電ドライエッチング装置	(株)アルバック	5,290円	8,460円	10,570円	グリーンルーム1
	B10	ドライエッチング装置	サムコ(株)	910円	1,450円	1,810円	グリーンルーム2
	B11	電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置	(株)エリオニクス	3,630円	5,800円	7,250円	グリーンルーム2
B12	シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム	住友精密工業(株)	4,230円	6,770円	8,470円	グリーンルーム1	
B13	シリコン犠牲層ドライエッチングシステム	XACTIX	2,130円	3,410円	4,270円	グリーンルーム2	
B14	赤外フェムト秒レーザー加工装置	AVESTA PROJECT	3,550円	5,680円	7,100円	加工・評価室2	
B15	レーザーアニール装置	AOV(株)	3,370円	5,390円	6,730円	加工・評価室2	
B16	紫外線ナノインプリントボンダライメント装置	ズース・マイクロテック(株)	4,520円	7,240円	9,050円	イロールーム	
B17	基板接合装置	ズース・マイクロテック(株)	4,110円	6,580円	8,220円	イロールーム	
B18	レーザータイピング装置	(株)東京精密	6,780円	10,850円	13,560円	加工・評価室1	
B19	タイピングソー	(株)DISCO	610円	980円	1,230円	加工・評価室1	
B20	真空マウンター	日本電気(株)	530円	850円	1,060円	加工・評価室1	
B21	紫外線照射装置	(株)テクノビジョン	230円	370円	470円	加工・評価室1	
B22	エキスパンド装置	(株)テクノビジョン	120円	200円	250円	加工・評価室1	
B23	ウェッジワイヤボンダ	ハイソル(株)(ウエスト・ボンダ社)	260円	420円	530円	加工・評価室2	
B24	ボールワイヤボンダ	ハイソル(株)(ウエスト・ボンダ社)	270円	430円	540円	加工・評価室2	
B25	ワイヤボンダ	ハイソル(株)(ウエスト・ボンダ社)	240円	390円	490円	加工・評価室2	
B26	ナノインプリントシステム	Obducat Technologies AB社	1,080円	1,720円	2,150円	イロールーム	
B27	赤外透過評価検査/非接触厚み測定機	(株)モリテックス	1,020円	1,630円	2,030円	イロールーム	
B51	バブル成膜装置	SCS	360円	570円	720円	桂グリーンルーム	
B52	ICP-RIE装置	(株)アルバック	500円	810円	1,010円	桂グリーンルーム	
B53	簡易RIE装置	サムコ(株)	330円	520円	650円	桂グリーンルーム	
B54	ウエハ接合装置	ボンドテック(株)	4,560円	7,300円	9,120円	桂グリーンルーム	
B55	ナノインプリント装置	(株)マルニ	180円	280円	350円	桂グリーンルーム	
B56	タイピング装置	(株)DISCO	570円	920円	1,150円	桂グリーンルーム	

装置群	No.	装置等		利用料金(一時間当り)			設置場所
		機器名	メーカー名	タイプA	タイプB	タイプC	
C ナノ材料分析・評価装置	C1	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	4,830円	7,720円	9,650円	加工・評価室1
	C2	分析走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	6,720円	10,760円	13,440円	加工・評価室1
	C3	高速液中原子間力顕微鏡	(株)生体分子計測研究所	2,570円	4,110円	5,140円	加工・評価室2
	C4	走査型プローブ顕微鏡システム	JPKインストルメンツ	2,340円	3,740円	4,670円	加工・評価室2
	C5	共焦点レーザー走査型顕微鏡	オリンパス(株)	2,500円	4,000円	5,000円	加工・評価室2
	C6	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス(株)	1,000円	1,610円	2,010円	加工・評価室1
	C8	全反射励起蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	2,040円	3,270円	4,090円	加工・評価室2
	C9	長時間撮影蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	1,550円	2,480円	3,110円	加工・評価室2
	C10	X線回折装置	(株)リガク	2,720円	4,350円	5,440円	加工・評価室1
	C11	分光エリプソメーター	大塚電子(株)	1,660円	2,650円	3,310円	クリーンルーム2
	C12	光ピンセットシステム	JPKインストルメンツ	1,960円	3,140円	3,920円	加工・評価室2
	C13	ゼータ電位・粒径測定システム	大塚電子(株)	1,070円	1,720円	2,150円	加工・評価室2
	C14	ダイナミック光散乱光度計	大塚電子(株)	1,430円	2,290円	2,860円	加工・評価室2
	C15	触針式段差計1	BRUKER	460円	740円	920円	クリーンルーム2
	C15	触針式段差計2	BRUKER	460円	740円	920円	加工・評価室1
	C16	マイクロシステムアナライザ	ポリテックジャパン(株)	2,830円	4,530円	5,660円	加工・評価室1
	C17	(プローバ)	(株)日本マイクロニクス	630円	1,010円	1,260円	加工・評価室1
	C18	(真空プローバ)	カスケード・マイクロテック(株)	2,470円	3,950円	4,940円	加工・評価室1
	C19	パワーデバイスアナライザ+ (C17プローバ)	アジレント・テクノロジー(株)	800円	1,280円	1,600円	加工・評価室1
	C20	インピーダンスアナライザ+ (C18真空プローバ)	アジレント・テクノロジー(株)	330円	530円	660円	加工・評価室1
	C21	光ヘテロダイン微小振動測定装置	ネオアーク(株)	1,060円	1,690円	2,110円	加工・評価室2
	C22	超微小材料機械変形評価装置	(株)エリオニクス	1,060円	1,690円	2,110円	加工・評価室2
	C24	セルテストシステム	(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)	1,050円	1,680円	2,100円	加工・評価室2
	C25	卓上顕微鏡(SEM)	(株)日立ハイテクノロジーズ	390円	620円	780円	クリーンルーム1
	C26	高周波伝送特性測定装置 (C27+C28+C29)	(株)アポロウェーブ	350円	560円	700円	加工・評価室1
	C27	(RFプローブキット)	(株)アポロウェーブ	140円	230円	290円	加工・評価室1
	C28	(ネットワークアナライザ)	(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)	360円	570円	710円	加工・評価室1
	C29	(半導体パラメータアナライザ)	(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)	350円	560円	700円	加工・評価室1

備考

- 上記表中の利用料は以下の利用タイプに区分された1時間当たりの機器利用に係る金額(消費税相当額を含む)であり、これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が
 - ・タイプA: 学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用、中小企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく
 - ・タイプB: 中小企業を除く企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用 及び ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利
 - ・タイプC: ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない企業の単独利用
- 1時間未満の機器利用及び1時間を超える機器利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。
- 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。
- 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。
- 中小企業とは中小企業基本法第2条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。

業種分類	中小企業基本法の定義
製造業その他	資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業	資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業	資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業	資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

表 2. 装置等の利用負担金の上限

利用者種別	利用料 (1 テーマ当たり)
(1) 京都大学の教職員及び学生	324万円
(2) 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者	
(3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者	
上記以外の者	1,404万円

備考

- 上記表中の装置利用料は、1 テーマ当たりの利用に係る上限額 (消費税相当額を含む) です。
なお、1 テーマの継続期間6ヶ月です。

表 3. 技術代行における技術料

1 時間当たり
3,400円

備考

- 上記表中の料金は、1 時間の技術代行にかかる金額 (消費税相当額を含む) であり、これに利用時間数を乗じた金額を技術料とします。
なお、上記の利用時間は、装置時間と事前検討に要する時間等を合計した時間とします。
- 1 時間未満の技術代行及び1 時間を超える技術代行に係る 1 時間未満の端数については、それぞれ 1 時間の技術代行として、技術料を算出するものとします。
- なお、技術代行においても、上記の装置利用負担金及び表 4 の基本料金を負担いただきます。

表 4. 基本料金表

利用者種別	基本料金 (1人・1時間当たり)
(1) 京都大学の教職員及び学生	500円
(2) 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者	
(3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者 でかつ、ナノプラットフォーム事業の利用者	
(4) ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業	800円
(5) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者 かつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者	
(6) ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業	1,000円
(7) 企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者	
(8) その他、上記 (1)~(7) に該当しない者	

備考

- 上記表中の利用料は、1 時間当たりの実験室等利用に係る金額 (消費税相当額を含む) であり、これに実験室等の利用時間数を乗じた金額を 1 人当たりの基本料金とします。
- 複数の者が実験室等を利用する場合については、上記 1 の 1 人当たりの基本料金に実験室等の利用人数を乗じた金額を基本料金とします。

表 5. サテライトラボ (専有部分) ・セミナー室の利用料金

実験室等	利用料	
	1 日当たり	1 時間当たり
サテライトラボ (専有部分) セ ミナー室	165円	21円

備考

- 上記表中の料金は、実験室等の床面積 1 平方メートルあたりの 1 日又は 1 時間の利用にかかる金額 (消費税相当額を含む) であり、これに当該実験室等の床面積及び利用日数又は利用時間数を乗じた金額とします。
- 1 時間未満の実験室等利用及び 1 時間を超える実験室等利用に係る 1 時間未満の端数については、それぞれ 1 時間の実験室等利用と
利用料金を算出するものとします。
- 複数の実験室等を利用する場合については、各実験室等の利用料を合算した金額を利用料金とします。

表 6. 装置等の利用中止に伴うキャンセル料

区 分	キャンセル料
利用開始日の 8 日前から 3 0 日前まで	利用負担金の額の 5 0 %
利用開始日当日から 7 日前まで	利用負担金の額の 1 0 0 %

備考

キャンセル料に円未満の端数が出た場合は、その端数を切り上げるものとします。

表7. 技術補助における技術料

※技術補助とは、利用者からの依頼、もしくはナノハブ職員からの提案に基づいて行う下記のような業務です。

- (1)ナノハブ職員が、利用時に立ち会って適宜行う装置操作等の補助
- (2)ナノハブ職員との利用開始後の技術相談（なお、利用開始前の技術相談は無料です。）
- (3)ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプロセス条件最適化検討
- (4)ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプログラミング

1 時間当たり
3,400円

備考

- 1 上記表中の料金は、1 時間の技術補助にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、これに利用時間数を乗じた金額を技術料とします。 なお、上記の利用時間は、装置時間と事前検討に要する時間等を合計した時間とします。
- 2 1 時間未満の技術補助及び1 時間を超える技術補助に係る1 時間未満の端数については、それぞれ1 時間の技術補助として、技術料を算出するものとします。但し、短時間で対応可能な場合は除きます。

表8. 事前講習費（オペレ費）

※技術講習とは、利用者が初めて使用する装置について、事前に操作法などを修得していただく講習です。

利用者種別	事前講習費（1時間当たり）
(1) 京都大学の教職員及び学生 (2) 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者 かつ、ナノプラットフォーム事業の利用者 (4) ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業	1,700円
(5) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者 かつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者 (6) ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業	2,720円
(7) 企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者 (8) その他、上記（1）～（7）に該当しない者	3,400円

備考

- 1 上記表中の料金は、1 時間の事前講習にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、これに利用時間数を乗じた金額を事前講習費とします。
- 2 1 時間未満の事前講習及び1 時間を超える事前講習に係る1 時間未満の端数については、それぞれ1 時間の事前講習として、算出するものとします。但し、短時間で対応可能な場合は除きます。
- 3 なお安全教育（初めてナノハブを利用される方に対して、施設・装置の利用に関する注意点を伝えるもの）については無料です。
- 4 上記事前講習費に加えて
 - ・表9に示す事前講習時の装置利用負担金
 - ・表4に示した基本料金
 - ・事前講習に要する消耗品費
 を合わせて負担していただきます。

表9. 事前講習費時の装置負担金

事前講習に用いる試料と利用者種別によって下表のように区分します。

利用者種別	ナノハブ拠点の準備する標準試料を用いた事前講習時の装置利用負担金	ナノハブ拠点の準備する標準試料以外の試料を用いた事前講習時の装置利用負担金
(1) 京都大学の教職員及び学生 (2) 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者 かつ、ナノプラットフォーム事業の利用者 (4) ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業	表1（タイプA）に示した装置利用負担金の半額（表10）	表1（タイプA）に示した装置利用負担金
(5) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者 かつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者 (6) ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業	表1（タイプB）に示した装置利用負担金の半額（表10）	表1（タイプB）に示した装置利用負担金
(7) 企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者 (8) その他、上記（1）～（7）に該当しない者	表1（タイプC）に示した装置利用負担金の半額（表10）	表1（タイプC）に示した装置利用負担金

表 10. 事前講習時の装置等の利用負担金表

装置群	装置等			利用料金(一時間当り)			設置場所
	No.	機器名	メーカー名	タイプ A	タイプ B	タイプ C	
A ナノリソグラフィ装置	A1	高速高精度電子ビーム描画装置	(株)エリオニクス	13,220円	21,150円	26,430円	エイロールーム
	A2	露光装置 (ステッパ)	(株)ニコン	5,290円	8,460円	10,570円	エイロールーム
	A3	レーザー直接描画装置	(株)日本レーザー(Heiderberg Instruments社)	3,590円	5,740円	7,170円	エイロールーム
	A4	高速マスクレス露光装置	(株)ナリスシステムソリューションズ	2,040円	3,260円	4,080円	エイロールーム
	A5	両面マスクアライナー	ズース・マイクロテック(株)	1,430円	2,280円	2,850円	エイロールーム
	A6	紫外線露光装置	ミカサ(株)	220円	350円	440円	エイロールーム
	A7	厚膜フォトレジスト用スピニング装置	ズース・マイクロテック(株)	780円	1,250円	1,560円	エイロールーム
	A8	レジスト塗布装置	(株)カナメックス	400円	630円	790円	エイロールーム
	A9	スプレーコータ	ウシオ電機(株)	500円	810円	1,010円	エイロールーム
	A10	レジスト現像装置	(株)カナメックス	400円	630円	790円	エイロールーム
	A11	ウエハスピン洗浄装置	(株)カナメックス	740円	1,180円	1,470円	エイロールーム
	A12	ICP質量分析装置	アジレント・テクノロジー(株)	1,230円	1,960円	2,450円	エイロールーム
	A13	超微細インクジェット描画装置	(株)SDテクノロジ	540円	860円	1,080円	エイロールーム
	A14	有機現像液型レジスト現像装置	(株)カナメックス	530円	850円	1,060円	エイロールーム
	A15	大面積超高速電子線描画装置	(株)アドバンテスト	17,450円	27,910円	34,890円	加工・評価室 1
B ナノ材料加工・創製装置	A51	E B 露光装置	(株)東京テクノロジー	480円	770円	970円	桂クリーンルーム
	A52	ステッパ	(株)大日本科研	4,680円	7,480円	9,350円	桂クリーンルーム
	A53	移動マスク紫外線露光装置	(株)大日本科研	2,160円	3,450円	4,320円	桂クリーンルーム
	A54	両面マスクアライナー露光装置	ユニオン光学(株)	340円	540円	680円	桂クリーンルーム
	B1	多元スパッタ装置 (仕様 A)	キャンアネルパ(株)	2,020円	3,230円	4,040円	加工・評価室 1
	B2	多元スパッタ装置 (仕様 B)	キャンアネルパ(株)	1,920円	3,080円	3,850円	加工・評価室 1
	B3	電子線蒸着装置	キャンアネルパ(株)	1,590円	2,540円	3,170円	クリーンルーム
	B4	真空蒸着装置	(株)サンバック	310円	500円	620円	加工・評価室 1
	B5	プラズマCVD装置	住友精密工業(株)	3,210円	5,140円	6,420円	クリーンルーム 1
	B6	集束イオンビーム走査電子顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)	6,470円	10,360円	12,950円	加工・評価室 1
	B7	熱酸化炉	光洋サーモシステム(株)	470円	750円	940円	クリーンルーム 2
	B8	深堀りドライエッチング装置	サムコ(株)	2,640円	4,220円	5,270円	クリーンルーム 1
	B9	磁気中性線放電ドライエッチング装置	(株)アルバック	2,640円	4,230円	5,290円	クリーンルーム 1
	B10	ドライエッチング装置	サムコ(株)	450円	730円	910円	クリーンルーム 2
	B11	電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置	(株)エリオニクス	1,810円	2,900円	3,630円	クリーンルーム 2
	B12	シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム	住友精密工業(株)	2,120円	3,390円	4,230円	クリーンルーム 1
	B13	シリコン犠牲層ドライエッチングシステム	XACTIX	1,070円	1,710円	2,130円	クリーンルーム 2
	B14	赤外フェムト秒レーザー加工装置	AVESTA PROJECT	1,770円	2,840円	3,550円	加工・評価室 2
	B15	レーザーアニール装置	AOV(株)	1,680円	2,690円	3,370円	加工・評価室 2
	B16	紫外線ナノインプリントボンダライメント装置	ズース・マイクロテック(株)	2,260円	3,620円	4,520円	エイロールーム
	B17	基板接合装置	ズース・マイクロテック(株)	2,050円	3,290円	4,110円	エイロールーム
	B18	レーザーダイシング装置	(株)東京精密	3,390円	5,430円	6,780円	加工・評価室 1
	B19	ダイシングソー	(株)DISCO	310円	490円	610円	加工・評価室 1
	B20	真空マウンター	日本電気(株)	260円	420円	530円	加工・評価室 1
	B21	紫外線照射装置	(株)テクノビジョン	120円	190円	230円	加工・評価室 1
	B22	エキスパンド装置	(株)テクノビジョン	60円	100円	120円	加工・評価室 1
	B23	ウェッジワイヤボンダ	ハイソル(株)(ウエスト・ボンダ社)	130円	210円	260円	加工・評価室 2
	B24	ボールワイヤボンダ	ハイソル(株)(ウエスト・ボンダ社)	140円	220円	270円	加工・評価室 2
	B25	ダイボンダ	ハイソル(株)(ウエスト・ボンダ社)	120円	200円	240円	加工・評価室 2
	B26	ナノインプリントシステム	Obducat Technologies AB社	540円	860円	1,080円	エイロールーム
	B27	赤外透過評価検査/非接触厚み測定機	(株)モリテックス	510円	810円	1,020円	エイロールーム
	B51	バブル成膜装置	SCS	180円	290円	360円	桂クリーンルーム
B52	ICP-RIE装置	(株)アルバック	250円	400円	500円	桂クリーンルーム	
B53	簡易RIE装置	サムコ(株)	160円	260円	330円	桂クリーンルーム	
B54	ウエハ接合装置	ボンドテック(株)	2,280円	3,650円	4,560円	桂クリーンルーム	
B55	ナノインプリント装置	(株)マルニ	90円	140円	180円	桂クリーンルーム	
B56	ダイシング装置	(株)DISCO	290円	460円	570円	桂クリーンルーム	

装置群	No.	装置等		利用料金(一時間当り)			設置場所
		機器名	メーカー名	タイプA	タイプB	タイプC	
C ナノ材料分析・評価装置	C1	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	2,410円	3,860円	4,830円	加工・評価室1
	C2	分析走査電子顕微鏡	(株)日立ハイテクノロジーズ	3,360円	5,380円	6,720円	加工・評価室1
	C3	高速液中原子間力顕微鏡	(株)生体分子計測研究所	1,280円	2,050円	2,570円	加工・評価室2
	C4	走査型プローブ顕微鏡システム	JPKインストルメンツ	1,170円	1,870円	2,340円	加工・評価室2
	C5	共焦点レーザー走査型顕微鏡	オリンパス(株)	1,250円	2,000円	2,500円	加工・評価室2
	C6	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス(株)	500円	800円	1,000円	加工・評価室1
	C8	全反射励起蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	1,020円	1,640円	2,040円	加工・評価室2
	C9	長時間撮影蛍光イメージングシステム	オリンパス(株)	780円	1,240円	1,550円	加工・評価室2
	C10	X線回折装置	(株)リガク	1,360円	2,180円	2,720円	加工・評価室1
	C11	分光エリプソメーター	大塚電子(株)	830円	1,330円	1,660円	クリーンルーム2
	C12	光ピンセットシステム	JPKインストルメンツ	980円	1,570円	1,960円	加工・評価室2
	C13	ゼータ電位・粒径測定システム	大塚電子(株)	540円	860円	1,070円	加工・評価室2
	C14	タイナミック光散乱光度計	大塚電子(株)	710円	1,140円	1,430円	加工・評価室2
	C15	触針式段差計1	BRUKER	230円	370円	460円	クリーンルーム2
	C15	触針式段差計2	BRUKER	230円	370円	460円	加工・評価室1
	C16	マイクロシステムアナライザ	ポリテックジャパン(株)	1,420円	2,270円	2,830円	加工・評価室1
	C17	(プローバ)	(株)日本マイクロニクス	320円	500円	630円	加工・評価室1
	C18	(真空プローバ)	カスケード・マイクロテック(株)	1,230円	1,980円	2,470円	加工・評価室1
	C19	パワーデバイスアナライザ+ (C17プローバ)	アジレント・テクノロジー(株)	400円	640円	800円	加工・評価室1
	C20	インピーダンスアナライザ+ (C18真空プローバ)	アジレント・テクノロジー(株)	170円	270円	330円	加工・評価室1
	C21	光ヘテロダイン微小振動測定装置	ネオアーク(株)	530円	850円	1,060円	加工・評価室2
	C22	超微小材料機械変形評価装置	(株)エリオニクス	530円	850円	1,060円	加工・評価室2
	C24	セルテストシステム	(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)	530円	840円	1,050円	加工・評価室2
	C25	卓上顕微鏡(SEM)	(株)日立ハイテクノロジーズ	200円	310円	390円	クリーンルーム1
	C26	高周波伝送特性測定装置 (C27+C28+C29)	(株)アポロウェーブ	180円	280円	350円	加工・評価室1
	C27	(RFプローブキット)	(株)アポロウェーブ	70円	120円	140円	加工・評価室1
	C28	(ネットワークアナライザ)	(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)	180円	280円	360円	加工・評価室1
	C29	(半導体パラメータアナライザ)	(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)	180円	280円	350円	加工・評価室1

備考

- 上記表中の利用料金は以下の利用タイプに区分された1時間当たりの機器利用に係る金額(消費税相当額を含む)であり、これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が
 - ・タイプA: 学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用、中小企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく
 - ・タイプB: 中小企業を除く企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用 及び ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利
 - ・タイプC: ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない企業の単独利用
- 1時間未満の機器利用及び1時間を超える機器利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。
- 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料金を合算した金額が利用料金となります。
- 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。
- 中小企業とは中小企業基本法第2条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。